

# 高度研所属学生の藤本羽海君 国際会議 Photomask Japan 2024 にて 「Best Academic Poster Presentation 賞」を受賞

兵庫県立大学高度産業科学技術研究所の所属学生の藤本羽海君が 2024/4/16-4/18 に開催された国際会議 Photomask Japan 2024 にて「Best Academic Poster Presentation 賞」を受賞しました。

Photomask Japan は半導体基板のフォトマスク開発に携わる企業、要素技術の開発を進める国研、大学、企業の研究者や技術者が一同に集まり、成果を発表する国内最大のマスク原版に関する国際会議です。

藤本君は放射光施設ニュースバルで波長 6.7 nm の Beyond EUV リソグラフィー用多層膜の開発を進めています。Beyond EUV は次世代のリソグラフィーで、実用的な多層膜の開発が重要となっています。今回の発表では多層膜材料である炭素の高密度成膜条件を探索した結果が評価されました。この賞を励みに、研究に全力を尽くしたいとコメントしています。

